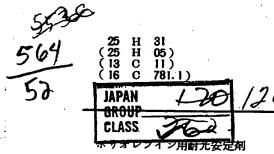
2569/69 Light stabilisers for polyolefins are carbanilide cpds. of formula:-

HO
$$\stackrel{\circ}{\underset{R_2}{\longleftarrow}}$$
 NH-C-NH- $\stackrel{\circ}{\underset{\longrightarrow}{\longleftarrow}}$

(where R_1 and R_2 are lower alkyl). They are prepd. by the reaction of an aminophenol of the formula:-

with phenylisocyanate. The stabiliser is compatible with the polyolefin, does not sublime and has excellent light stabilising effect when used in an amt. of 0.01-2.0 wt.% based on polyolefin. 9.4.66 (Non-Con) as 22390/66 SANKYO CO., LTD & ASAHI CHEM. IND. CO., LTD. (3.2.69)



特許公報

特許出願公告 昭 44—2569 公告 昭44. 2. 3

20 · 3 · 3 · 3 · (全2頁) 對主新計算

特 願 昭 41-22390

出願日 昭 41.4.9

発明者 村山圭介

東京都品川区広町1の2の58

三共株式会社中央研究所内

同 森村正治

同所

同 吉岡孝雄

同所

同 北岡惇

延岡市旭町5の1021

雨 赤木三郎

東京都品川区広町1の2の58

三共株式会社生産技術研究所内

同 車田知之

同所

同 渡辺一郎

同所

出 願 人 三共株式会社

東京都中央区日本橋本町3の1の

b

代 表 者 鈴木万平

出 願 人 旭化成工業株式会社

大阪市北区堂島浜通1の25の1

代表者 宮崎輝

代理 人 弁理士 樫出庄治

発明の詳細な説明

本発明は式

$$HO \xrightarrow{R_1} NH - C - NH \xrightarrow{Q} (1)$$

を有するカルバニリド化合物よりなるポリオレフ イン用耐光安定剤に関するものである。

上記式中R: およびR: は同一または異なりてメチル,エチル,プロピル,プチル若しくは第三級プチルのような低級アルキル基を示す。

従来これらに類似したポリオレフイン用安定剤 として3,5ージ第三級プチルー4ーヒドロキシ チオカルパニリドおよび 1,3-ジーαーナフチルチオ尿素が特公昭 40-13263および同36-12789に記載されている。

しかしながらこれらのポリオレフインに対する 耐熱および耐光の効力はあまり強くないという欠 点を有している。

本発明者等はポリオレフインを汚染せずしかもポリオレフインに対して優れた耐光効果を有する化合物を鋭意研究した結果,前配式(I)を有する化合物が特に優れた耐光安定作用を有するととを知り本発明を完成した。

本発明は前記式(I)を有するカルパニリド化合物よりなるととを特徴とするポリオレフイン用耐光安定剤である。

本耐光安定剤は非昇華性であり、ポリオレフインに対する相溶性もよく非汚染性でしかも優れた耐光安定作用を有するものである。

本発明のポリオレフインとは高圧、低圧ポリエチレン、ポリプロピレン、ポリスチレンおよびその他のポリオレフイン類或はオレフイン共重合体であり、上記式(I)の化合物を該ポリオレフィンに使用されりる。本耐光安定剤は常法に従つて上記重合体に添加される。その際の耐光安定剤の量は上記重合体の約0.01万至2%(重量)である。

本発明において使用される前記式(1)を有する 化合物は新規化合物であつて式

(式中R: およびR: は前述したものと同一である。)を有するアミノフエノール化合物を式

$$O = C = N - \left\langle \right\rangle$$

を有するフェニルイソシアネートと無水の条件下 不活性溶媒の存在下で反応させることによつて得 られる。

上記製法を更に具体的に説明するために以下に 製造例を示す。

製造例

2ーメチルー 4 ーヒドロキシー 5 一第三級プチルカルバニリドの製造

3ーメチルー 4ーアミノー 6 一第三級プチルフ

エノール4.0gおよびペンゼン50mlの溶液 に室温で攪拌下イソシアン酸フエニル2.7gを 滴下し滴下終了後室温で3時間,続いて50~6 0℃で5時間加温攪拌する。反応後析出した結晶 を戸取し、母液を濃縮して得られる結晶と合せて ペンゼン:アセナン(5:1)の混合溶媒より再 結晶すると、融点209~210℃の白色結晶と して所望の生成物4.8g(収率71.8%)が 得られる。

分析值

C14H22O2N2 に対する 計算値, C;72.45, H;7.43, N;9.39

実験値, C;72.64, H;7.50, N;9.26

次に本耐光安定剤がポリオレフインに対して顕 著な耐光安定効果を付与することを示す試験例を 挙げる。尚試験例中の部は全て重量部である。

試験例

ポリプロピレン100部に2ーメチルー4ーヒドロキシー5 - 第三級プチルカルバニリド0.25部を熔融混合し、0.5mmの厚さのシートに加熱加圧成型する。このものをJIS-L-1044-3-8に規定された耐光試験機中に入れ、45℃で紫外線を照射し、脆化するまでの時間を測定した結果は次の通りである。尚対照として公知のポリオレフイン用耐光安定剤である2-(2′ーヒドロキシー5′ーメチルフエニル)ペンゾトリアゾール、2、2′ージヒドロキシー3、3′ージ第三級プチルー5、5′ージメチルジフエニルメタン、3、5ージ第三級プチルー4ーヒドロキシチオカルバニリドおよび1、3ージーαーナフチルチオ尿素を同量使用して同様の方法で試験した結果を併記する。

添加した耐光安定剤	脆化時間 (時間)
2ーメチルー4ーヒドロキシー5ー第三級 プチルカルパニリド	200
2ー(2'ーヒドロキシー5'ーメチルフ エニル)ペンゾトリアゾール	80
2, 2′ージヒドロキシー3, 3′ージ第 三級プチルー5, 5′ージメチルジフエニ ルメタン	100
3,5ージ第三級プチルー4ーヒドロキシ チオカルパニリド	60
1,3一ジーαーナフチルチオ尿繁	60
な し	60

特許請求の範囲

(式中R: およびR: は同一または異なりて低級 アルキル基を示す。)を有するカルバニリド化合 物よりなることを特徴とするポリオレフィン用耐 光安定剤。